เอกสารอ้างอิง

[1] A. Ohtomo, M. Kawasaki, T. Koida, K. Masubuchi, H. Koinuma, Y. Sakurai, Y.Yoshida, T. Yasuda, and Y. Segawa, Appl. Phys. Lett. **72**, 2466 (1998).

[2] T. Minemoto, T. Negami, S. Nishiwaki, H. Takakura, and Y. Hamakawa, Thin Solid Films **372**, 173 (2000).

[3] W. I. Park, G. C. Yi, and H. M. Jang, Appl. Phys. Lett. **79**, 2022 (2001).

[4] R. D. Vispute, S. Choopun, Y. H. Li, D. M. Chalk, S. B. Ogale, R. P. Sharma, T. Venkatesan, and A. Iliadis, Mat. Res. Soc. Symp. Proc. **583**, 189 (2000).

[5] T. Makino, Y. Segawa, M. Kawasaki, A. Ohtomo, R. Shiroki, K. Tamura, T. Yasuda and H. Koinuma, Appl. Phys. Lett. **78**, 1237 (2001).

[6] A. K. Sharma, J. Narayan, J. F. Muth, C. W. Teng, C. Jin, A. Kvit, R. M. Kolbas, and O. W. Holland, Appl. Phys. Lett. **75**, 3327 (1999).

[7] A. K. Sharma, C. Jin, A. Kvit, J. Narayan, J. F. Muth, and O. W. Holland, Abstracts of MRS Spring 2000 Meeting **J3.19**, 179 (2000).

[8] G. Xiang, J. Wilkinson, B. Mischuck, S. Tuzemen, K. B. Ucer, and R. T. Williams, Appl. Phys. Lett**. 80** ,1995 (2002).

[9] Y-S Chang, J-M Ting, Thin Solid Films, **398**,29-34 (2001).

[10] S. Choopun,Ph.D. dissertation,Chemical Physics Program,University of Maryland,College Park (2001) unpublished.

[12] R.W.Berry, P.M. Hall, and M.T.Harris, *Thin Film Technology*, New Jersey, D.Van Nostrand,164-187 (1968).

[13] R.F.Bunshah, *Handbook of Deposition Technologies for Films and Coatings*, 2nd ed., New Jersey, Noyes Publications, 861 (1994).

[14] T.Burakowski, W. Tadeusz, , *Surface engineering of Metals : Principles, Equipment Technologies*, New York, CRC Press, 592 (1999).

[15] B.Chapman,, *Glow Discharge Processes*, New York, John Wiley & Sons, 406 (1980).

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

[16] N.T.M Dennis, and T.A. Heppell, *Vacuum System Design*, London, Chapman and Hall Ltd, 223 (1968).

[17] A.R.Elashabini, and D.B.Fred , 1997, *Thin Film Technology Handbook*, New York, McGraw-Hill (1997).

[18] A.Guthrie, *Vacuum Technology*, New York, John Wiley. 532 (1963).

[19] N.S.Harris, *Modern Vacuum Practice*, New York, McGraw-Hill, 315 (1989).

[20] D.M.Hoffman,S. Bawa , and H.T. John , 1998, *Handbook of Vacuum Scinece and Technology*, Toronto, Academic Press, 835 (1998).

[21] L.I. Maissel, and R. Gland, *Handbook of Thin Film Technology*, New York, McGraw-Hill (1970).

[22] D.M. Mattox, *Handbook of Physical Vapor Deposition (PVD) Processing*, New Jersey, Noyes Publications, 917 (1998).

[23] S.L. Rohde, and W.D. Munz, *"Sputter Deposition" in Advanced Surface Coatings* : *a Handbook of Surface Engineering*, Edited by D.S. Rickerby, and A. Matthews, New York, Chapman and Hall, 103-105 (1991).

[24] D.L. Smith, *Thin-film Deposition : Principle and Practice*, New York, McGraw-Hill, 616 (1995).

[25] J.L. Vossen, and W. Kerns, *Thin Film Processes*, New York, Academic Press, 552 (1978).

[26] สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์, พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ และพิษณุ เจริญสมศักดิ์, *การวิจัยและพัฒนาการเคลือบฟิลม์บางด้วยวิธีสปัตเตอริง*, รายงานการวิจัยประจำปี 2529 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 115 (2529)

[27] ดุสิต เครืองาม, *Solid State Physics* ,ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (2521)

[28] S.Choopun ,R.D. Vispute, W.Noch,A. Basalmo ,R.P. Sharma ,T. Venkatesan , A.Iliadis , and D.C.Look ,Appl.Phys.Lett.**75**,3947 (1999).

[29] S.Choopun ,R.D. Vispute, W.Yang,R.P. Sharma , and T.Venkatesan, Appl.Phys. Lett.**80**,1592 (2002).

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

[30] C. Rincon ,S.M. Wasim ,G. Marin,R. Marquez,L. Nieves, and G. Sanchez Perez, J.Appl.Phys.**90**,4423 (2001).

[31] S.Yano ,R. Schroeder ,B. Ullrich , and H. Sakai , Thin Solid Films, **423**, 273-276 (2003).

[32] S.M. Wasim , G. Marín, C. Rincón, G. Sánchez Pérez , and A.E. Mora , J.Appl. Phys.**83**,3318 (1998).

[33] M. Rebien , W. Henrion , M. Bär ,and Ch.-H. Fischer , Appl. Phys. Lett.**80**,3518-3520 (2002).

[34] M.A. Jacobson , O.V. Konstantinov , D.K. Nelson , S.O. Romanovskii , and Z. Hatzopoulos , J. Crystal Growth.**230,**459-461 (2001).

[35] ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. *เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลือบในสุญญากาศและการประยุกต์ทางอุตสาหกรรม*. 2547.

[36] (No date). **"Sputtering System."** [Online].Available http://www.engi.ulst.ac.uk/.../sputtering/img001.gif (8 April 2005)

[37] (No date). **"Evaporation.**" [Online].Available http://www.techfak.uni-kiel.de/. ../evaporation.gif (8 April 2005)

[38] (No date). **"Particle Motion in Magnetic Field.**" [Online].Available http://www.saburchill.com/physics/images/121103120.jpg (8 April 2005)

[39] (No date). **"X-ray Diffraction.**" [Online].Available http://www.pubs.usgs.gov/.../ htmldocs/images/beam.jpg (8 April 2005)

[40] (No date). **"X-ray.**" [Online].Available http://www.ie.lbl.gov/ xray/Image15.gif (8 April 2005)

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved